

# 单层氮化硼薄膜（HBN）SiO<sub>2</sub>/Si 基 底

中文名称： 单层氮化硼薄膜（HBN）SiO<sub>2</sub>/Si 基底

英文名称： Monolayer boron nitride film（HBN）

货 号： ML1171

CAS 号： 7440-42-8

包 装： 4 英寸/6 英寸

参 数

4 英寸圆片，SiO<sub>2</sub>/Si 基底

6 英寸 圆片，SiO<sub>2</sub>/Si 基底

**保质期：** 1年常温干燥避光密封保存

**性 质**

**覆盖率：** 100%

**基 底：** SiO<sub>2</sub>/Si

**晶粒尺寸：** >4 um

**氧化层：** 300 nm

**硅：** 500 um

**应 用：** HBN 薄膜可被用作金属绝缘金属结构的超薄间隔层，以及电子的隧道阻挡层，使其具有广泛的应用，例如纳米电容器、场效应隧道晶体管。作为单分子膜还可被用作介质或基片。

**其他信息：** 常温干燥避光密封保存，保存期限 1 年。